



ResMap 273

抵抗率測定装置

4 探針法・手動・卓上型

ResMap273 は半導体業界に初めて導入された 300mm 用テーブルトップ型 4 探針法抵抗率測定装置です。これまでの ResMap モデルの能力や性能を拡張され、300 mm ウエハのプロセス開発や大型基板の薄膜特性のニーズに応えます。小型で頑丈な設計で ResMap 共通の測定精度と再現性を備えています。

Specifications			
ウエハ搬送方法	手動	エッジ除外 (最小)	1.5mm (プローブ中心から基板端まで)
ウエハサイズ	2インチ~12インチ	コンピューターシステム	Computer CPU 3.2GHz I3, 4GB memory, 1TB hard drive, operating system: Windows XP
最大径	12.2インチ(309.88mm)	SECS-II オプション	可能
最大角	8.6インチ(218mm)□		
標準測定時間	1点あたり1秒	マッピングパターン	円形マッピング (ノッチ/フラットに合わせる或いはフラットに沿う)、長方形マッピング、ラインスキャン (直径、半径、または直径に沿った任意の2点間、最小間隔0.1 mm)、ユーザーにて定義可能 (テンプレート)
標準ウエハ搬送時間	N/A	プロット	等高線 (間隔選択、1/3σ, 固定および自動)、3D、直線、データマップ、ヒストグラム、データシーケンス、半径方向および角度方向分布、各種モードのトレンドチャートが使用可能
標準ノッチ検出時間	N/A	データ	ResMapのデータファイルはすべて分析用にエクセル等のプログラムへ書き込みが可能
最大スループット	1分 (ウエハ、49点)	Facilities	
測定範囲	1 mΩ/sq - 10MΩ/sq (1 mΩ/sqに最適化可能)	工場側真空	不要
再現性	静止状態: ≤ ±0.02% 可動状態: ≤ ±0.1% (near by spots, typical)	電源	100V ~ 240V < 10 KVA
精度	≤ ±0.5% NIST規格による	寸法(幅×奥行×高)	15"× 18"× 10" (381mm×457mm×254mm)

NTE
NAGASE Group

ナガセテクノエンジニアリング株式会社

Creative Design Engineering, Inc.
20565 Alves Drive, Cupertino, CA 95014 USA
Tel: +1-408-736-7273 Fax: +1-408-738-3912
www.CDE-ResMap.com

Rev. 070701